

# Установки безмасковой литографии MIVA Technologies

Установки безмасковой литографии MIVA Technologies

**Производитель:**

MIVA Technologies

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

Установки безмасковой литографии MIVA Technologies серий 121XX/123XX/126XX и 201XX/203XX/206XX представляют собой высокопроизводительные генераторы изображений, подходящие как для производства фотошаблонов, так и для прямой печати на поверхности подложек.

Установки 121XX/123XX/126XX и 201XX/203XX/206XX основаны на принципе растровой проекционной литографии с матрицей микрозеркал, положение которых формирует изображение на поверхности образца. Большой размер матрицы позволяет получать самые высокие показатели производительности на рынке безмасковых генераторов изображений.

Установки серий 121XX/123XX/126XX специально разработаны для задач микроэлектроники и оснащены компактным рабочим столом с размерами 300x400 мм. Машины этой серии специального исполнения позволяют работать с разрешением до 1 мкм при высокой скорости печати.

## Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>121XX laser Mask Writer</b>	<b>123XX/126XX Dual LED Mask Writer</b>	<b>201XX laser Mask Writer</b>	<b>203XX/206XX Dual LED Mask Writer</b>
Максимальный размер подложки, мм	300×400		510×610	
Типоразмеры подложек	60×48 мм, 1"-12", нестандартные			
Разрешение, мкм	1	3/6	1	3/6

Источник излучения	Модуль УФ лазерных диодов	2 высоко- энергетичных СИД	Модуль УФ лазерных диодов	2 высоко- энергетичных СИД
Точность позиционирования, мкм	±1			
Неоднородность размеров элементов топологии	10% от минимального размера			
Максимальное отклонение положения элементов топологии от заданного положения по всей площади экспонирования, 3 σ	±2 мкм			
Возможность экспонирования излучением со следующими длинами волн	405 нм*	405 нм* для УФ- чувствительных материалов	405 нм*	405 нм* для УФ- чувствительных материалов
		525 нм для фотоэмульсии		525 нм для фотоэмульсии
Автофокус	Лазерный			
Разрешение системы позиционирования по осям X и Y	20 нм			
Разрешение системы позиционирования по оси Z	625 нм			
Язык интерфейса управления установкой	русский			
Защита от вибраций	Встроенное антивибрационное основание			

Требования к среде	Температура 21 ± 1 °С Влажность 50%	
Электропитание	220 В, 50 Гц	
Сжатый воздух или азот	150 л/мин. при 5 бар	
Габариты (Ш×В×Г), мм	1100×1780×1050	1220×1780×1480
Вес, кг	700	750

\* другие под заказ